J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng. Vol. 32, No. 1, pp. 53-57 January 2019 DOI: https://doi.org/10.4313/JKEM.2019.32.1.53 ISSN 1226-7945(Print), 2288-3258(Online)

TTIP가 첨가된 저온소성용 TiO₂ Paste를 이용한 DSSC의 효율 특성

권성열¹, 심창수², 양 욱²

¹ 부경대학교 전기공학과 ² 부경대학교 전기공학대학원

Efficiency Characteristics of DSSC Using TiO₂ Paste for Low Temperature Annealing with TTIP

Sung Yeol Kwon¹, Chang Soo Sim², and Wook Yang²

¹ Department of Electrical Engineering, Pukyong National University, Busan 48513, Korea

² Graduate School of Electrical Engineering, Pukyong National University, Busan 48513, Korea

(Received June 12, 2018; Revised July 7, 2018; Accepted July 10, 2018)

Abstract: Recently, the application field of solar panels is increasing. Accordingly, the demand for flexible devices is also steadily increasing. It is therefore necessary to develop TiO_2 paste for low-temperature annealing for flexible DSSC fabrication. In this study, the TiO_2 paste for low-temperature annealing with varying molar ratio of titanium isopropoxide (TTIP) was prepared, and DSSC was fabricated and its characteristics were compared. As a result, there was no deformation of the particles on the surface in the SEM data. However, the highest open circuit voltage, short circuit current, and fill factor were measured in the DSSC unit cell prepared by adding 0.5 mol of TTIP to the TiO_2 paste, and the highest efficiency was 4.148%.

Keywords: DSSC, TiO₂, Photo elctrode, TTIP, Solar cell

1. 서 론

염료감응형 태양전지(dye sensitized solar cell, 이 하 DSSC)는 반도체 산화물에 염료(dye)를 흡착한 광전 극(photo electrode), 상대전극(counter electrode), 그 리고 전해질(electrolyte)로 구성된다 [1-3]. DSSC의 광 전극은 광전변환에서 중요한 역할을 수행하며, 사용된 n형 전이금속 산화물이 입자 크기, 형상, 결정성, 표면 상태 및 분산상태 등이 DSSC의 효율에 큰 영향을 미친

Sung Yeol Kwon; sungyeol@pknu.ac.kr

Copyright ©2019 KIEEME. All rights reserved.

다 [4-6]. 그러므로 TiO₂층 형성은 염료와 함께 DSSC 의 효율을 결정짓는 요소 중에 하나이다 [7-9].

최근 flexible device에 대한 요구가 지속적으로 증 가하고 있다 [10,11]. 이러한 이유로 DSSC 제작 시 유연기판을 적용하기 위한 저온소성용 TiO₂ paste 제 조에 대한 연구가 필요해지고 있다.

본 연구에서는 광전극의 저온소성 제작을 위하여 가 수분해, 축합반응을 통해 TiO₂ 입자를 형성하여, TiO₂ 의 제조 시 전구체로 많이 활용되는 티타늄 이소프로폭 사이드(titanium isopropoxide, 이하 TTIP)를 binder 로 사용하였다. TiO₂ powder에 TTIP의 몰 비율을 달 리하여 첨가 후 TiO₂ paste를 제조하였다. 그 후 TiO₂ paste를 이용하여 DSSC를 제작 후 각각의 특성을 비 교하였다.

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

2. 실험 방법

2.1 TTIP를 첨가한 TiO₂ paste 제조

TiO₂ paste의 저온소성을 위해 유기바인더의 제거 후 TiO₂ 입자 간의 연결성을 유지시키기 위해 전구체 물질 인 TTIP를 적용하였다 [12,13]. 일반적으로 저온에서 TiO₂를 소성할 경우 입자 간의 연결이 좋지 않아 전자 의 흐름을 방해한다 [9]. TiO₂ powder (P25, sigmaaldrich)를 분산시키기 위해 1g의 TiO₂ powder에 D.I water를 넣어 30분 동안 마노유발로 분산시킨 후 TTIP를 TiO₂와의 mol 비율에 따라 표 1과 같이 다섯 종류로 나누어 마그네틱 교반기에서 2시간 동안 교반 하여 제작하였다.

Table 1. The molar ratio of TTIP used in TiO₂ paste.

Mark	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
TTIP:TiO ₂	0.1:1	0.3:1	0.5:1	0.7:1	0.9:1
TTIP (g)	1.8	5.4	9	12.6	16.2
TiO ₂ (g)	5	5	5	5	5

2.2 TiO₂ 광전극 제작

광전극 제작에 사용된 기판은 FTO glass (TEC 8, Pilkington)이다. FTO glass를 기판으로 사용한 이유 는 안정성이 보장된 기존 연구에서와 같은 조건에서 저온소성용 TiO₂ paste로 형성된 광전극을 이용한 DSSC를 제작하여 시험 후 기존 연구 결과와의 비교 시 정확한 비교 및 평가가 가능하기 때문이다.

준비된 기판을 아세톤, 에탄올로 각각 5분 동안 초 음파 세척하였다. 건조된 FTO glass 위에 70 µm 테이 프(PS25, Coretech)로 0.25 cm²의 활성 영역을 제외 한 부분에 테이프 캐스팅하였다. 이후 TiO₂ paste를 닥터 블레이드 방식으로 FTO glass에 도포하였다. 그 리고 열처리 오븐에서 120℃의 온도로 30분 동안 열처 리하였다. 열처리 오븐 내에서 냉각된 FTO glass를 N719염료[cis-diisothiocyanato-bis(2,2,-bipyridyl -4,4,-dicarboxylato) ruthenium(II) bis(tetrabutyl ammonium) 0.5 mMol]에 24시간 함침 후 에탄올로 흡착된 여분의 염료를 제거하여 제작하였다.

2.3 DSSC 제작

상대전극 제작 시 사용된 기판은 광전극 제작 에서와 동일한 FTO glass를 사용하였다. FTO glass에 전해질 주입을 위한 주입구를 천공하였다. 광전극 제작에서와 같은 방식으로 세척된 FTO glass에 테이프 캐스팅하였 다. 이후 닥터 블레이드 방식으로 Pt paste (Platisol T, Solaronix)를 도포하였다. 전기로에서 450℃의 온 도로 10분 동안 소성한 후 기판을 전기로 내에서 상온 까지 냉각시켜 Pt 상대전극을 제작하였다.

제작된 광전극과 상대전극 두 기판의 결합을 위해 surlyn film (Meltonix, Solaronix)을 광전극 기판의 활성영역 가장자리에 위치시켜 고정하였다. Surlyn film이 고정된 광전극 기판 위에 상대전극 기판의 전 해질 주입구의 위치가 surlyn film의 내부를 벗어나지 않도록 상대전극 기판을 정렬하여 클램프로 고정하였 다. 고정된 두 기판을 hot plate 온도 120°C에서 3분 동안 가열하여 surlyn film과 두 기판을 결합하였다. 결합된 두 기판은 상온까지 냉각 후 주입구를 통해 전 해질(acetonitrile base electrolyte 0.1M LiI, 0.6M DMPII, 0.05M I₂, 0.5 M TBP)을 주입하고 주입구를 밀봉하여 DSSC를 완성하였다. DSSC 제조 공정은 그 림 1에 표시하였다.



Fig. 1. DSSC fabrication process.

3. 결과 및 고찰

3.1 TiO₂ 광전극층의 SEM, XRD 측정

첨가된 TTIP의 가수분해, 축합반응으로 인한 TiO₂ 입자 생성 또는 사용된 TiO₂ powder 입자의 변화 [9] 를 확인하기 위하여 광전극의 표면을 SEM으로 측정한 결과를 그림 2에 표시하였으며, 그 결과 첨가된 TTIP mol 비율에 따른 표면적 변형 및 구성 물질보다 작은 입자는 확인되지 않았다.

형성된 TiO₂층의 결정성을 확인하기 위하여 측정된 XRD 결과를 그림 3에 나타내었다. XRD 결과 cps의 값은 2-0에 나타나는 물질의 양이 늘어날수록, 결정성 이 증가할수록 높아진다. 2-0 25.3° 근방에 나타나는 TiO₂ Anatase 상의 cps 최댓값은 첨가된 TTIP의 몰 비율이 0.1에서 0.9로 증가함에 따라 감소함을 확인하 였다. Cps 값의 감소는 (d)에서 (e)로 몰 비율이 증가 시켰을 때 1.257에서 848로 크게 감소하였다. 이 값은 TiO₂ paste 내에 함유된 TiO₂의 양과 결정성이 영향을 미친 것으로 보인다.

2-θ 25.3° 근방의 결과와 반대로 37.7° 근방의 cps 값 은 TTIP의 몰 비율이 증가할수록 높게 나타났다. 37.7° 근방에서는 TiO₂ Anatase 상과 SnO₂ 그리고 hydrogen titanium oxide가 검출되었으며, (e)에서 추가로 titanium oxide가 확인되었다. 측정 결과 37.7° 근방의 cps 값 은 (e)에서 1,236으로 크게 증가함을 보였다. 37.7° 근



Fig. 2. The surface of TiO₂ layer with TTIP molar ratio.



Fig. 3. XRD data of TiO₂ layer with TTIP molar ratio (a: 0.1 mol, b: 0.3 mol, c: 0.5 mol, d: 0.7 mol, and e: 0.9 mol).

방의 값은 상대적으로 TTIP의 몰 비율이 낮았던 (a), (b)에서 823, 689로 나타났지만 (c)에서 1,044로 상대 적으로 높게 나타났으며, (d)에서는 991로 약간 감소함 을 보였다.

3.2 TTIP 몰 비율에 따른 DSSC 측정 결과

TiO₂ paste 제조 시 첨가된 TTIP 몰 비율에 따라 각각 제작된 DSSC를 solar cell test system (TES, PROVA-200-24, 1 kW)으로 측정하였다. 측정 결과는 표 2와 그림 4에 나타내었다.

측정 결과 개방전압을 비롯한 단락전류 밀도, 충진 계수, 효율이 (a)에서 (c)로 TTIP의 첨가량이 증가함에 따라 증가함을 보였으며, (c)에서 (e)로 첨가량이 증가 함에 따라 다시 감소함을 나타내었다. (e)에서 단락전 류 밀도 및 최대 전류 값이 크게 감소함을 보였다.

Table 2. Electrical properties and efficiency by different additive amount of TTIP in TiO_2 paste.

Mark	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Additive amount	0.1 mol	0.3 mol	0.5 mol	0.7 mol	0.9 mol
V _{OC} (V)	0.749	0.754	0.771	0.760	0.743
J _{SC} (mA/cm ²)	7.294	8.402	8.572	8.270	6.891
Fill Factor (%)	61.438	61.229	62.617	61.322	61.883
I _{MAX} (mA)	1.450	1.790	1.881	1.699	1.378
V _{MAX} (V)	0.579	0.542	0.550	0.567	0.75
Eiffciency (%)	3.358	3.881	4.138	3.371	3.169



Fig. 4. I-V Curve by addition of differrent TTIP in TiO2 paste.

XRD 결과에서 (a)와 비교하여 2-0 25.3° 근방의 값 이 낮은 (b)와 (c), (d)에서의 효율 상승은 TTIP 가수 분해, 축합반응으로 식 (1), (2)에서와 같이 TiO₂로 결 정화되면서 기존 TiO₂ 입자 간의 연결성을 향상 [13] 시켜 FTO glass 기판까지의 전자 이동이 용이하여 전 류 밀도 상승을 가져온 것으로 보이며, 전류 밀도의 상승폭이 결정성 또는 함유량 감소에 의한 전자 이동 의 감소보다 큰 결과로 보인다.

$$Ti(OR)_{4} + 4H_{2}O \rightarrow Ti(OH)_{4} + 4ROH(hydrolysis)$$
(1)

$$Ti(OH)_4 \rightarrow TiO_2 x H_2 O + (2-x) H_2 O(condensation)$$
 (2)

4. 결 론

TiO₂ paste 제조 시 TiO₂ 대비 TTIP의 첨가량을 0.1 mol에서 0.9 mol까지 변화시켰을 때, 첨가량이 0.1 mol에서 0.5 mol까지 증가함에 따라 효율을 비롯한 개 방전압, 단락전류 밀도, 충진계수가 증가됨을 확인하였 으며, 0.5 mol에서 0.9 mol까지 첨가량이 증가함에 따 라 다시 감소함을 확인하였다. TTIP의 비율을 0.9 mol 로 높였을 때 단락전류 밀도 값이 크게 감소하였다.

본 실험에서 TiO₂ paste에 TTIP를 0.5 mol의 비율 로 첨가하여 제작된 DSSC에서 TiO₂ 입자 간의 연결 성 개선 및 FTO 기판까지의 전자의 이동 개선이 이루 어져 가장 높은 4.148%의 효율을 나타내었다.

Sung Yeol Kwon

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8007-1957

감사의 글

이 논문은 부경대학교 자율창의학술연구비(2017)에 의하여 연구되었음.

REFERENCES

 B. O'Regan and M. Grätzel, *Nature*, **353**, 737 (1991). [DOI: https://doi.org/10.1038/353737a0]

- [2] L. M. Peter, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 9, 2630 (2007).
 [DOI: https://doi.org/10.1039/b617073k]
- [3] T. W. Hamann, R. A. Jensen, A.B.F. Martinson, H. V. Ryswyk, and J. T. Hupp, *Energy Environ. Sci.*, 1, 66 (2008). [DOI: https:// doi.org/10.1039/b809672d]
- [4] M.K.I. Senevirathna, P.K.D.D.P. Pitigala, E.V.A. Premalal, K. Tennakone, G.R.A. Kumara, and A. Konno, *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*, **91**, 544 (2007). [DOI: https://doi.org/10.1016/ j.solmat.2006.11.008]
- [5] S. Y. Kwon, W. Yang, and Z. Y. Zhou, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 27, 115 (2014). [DOI: https:// doi.org/10.4313/JKEM.2014.27.2.115]
- [6] S. Y. Kwon, W. Yang, and Z. H. Zhang, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 27, 746 (2014). [DOI: https:// doi.org/10.4313/JKEM.2014.27.11.746]
- [7] H. J. Koo, J. Park, B. Yoo, K. Yoo, K. Kim, and N. G.

Park, *Inorg. Chim. Acta*, **361**, 677 (2008). [DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.ica.2007.05.017]

- [8] H. S. Park. S. Y. Kwon, and W. Yang, J. Korean Inst. Electr. Electron. Mater. Eng., 25, 537 (2012). [DOI: https://doi.org/ 10.4313/JKEM.2012.25.7.537]
- [9] T. Miyasaka and Y. Kijitori, J. Electrochem. Soc., 151, A1767 (2004). [DOI: https://doi.org/10.1149/1.1796931]
- [10] A. J. Medford, M. R. Lilliedal, M. Jørgensen, D. Aarø, H. Pakalski, J. Fyenbo, and F. C. Krebs, *Opt. Express*, 18, A272 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1364/OE.18.00A272]
- [11] F. C. Krebs, S. A. Gevorgyan, and J. Alstrup, J. Mater. Chem., 19, 5442 (2009). [DOI: https://doi.org/10.1039/b823001c]
- [12] D. Vorkapic and T. Matsoukas, J. Am. Ceram. Soc., 81, 2815
 (1998). [DOI: https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1998.tb02701.x]
- [13] Y. R. Jung, J. Y. Park, and H. B. Gu, *Mater. Lett.*, **138**, 268 (2015). [DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.09.135]